PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

10-213773

(43) Date of publication of application: 11.08.1998

(51)Int.CI.

G02B 26/10 B41J 2/44 HO4N 1/113

(21)Application number : 09-019496

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

(22)Date of filing:

31.01.1997

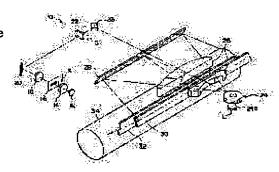
(72)Inventor: NARISAWA HIDETSUGU

(54) OPTICAL SCANNER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical scanner capable of easily changing three characteristic values of resolution (beam interval), a beam diameter and light quantity.

SOLUTION: Two beams radiated from a laser diode 12 having two optical points in a sub-scanning direction are successively passed through a collimeter lens 14, a slit 16, an expanding lens 18 for diffusing these beams to a main scanning direction, a cylinder lens 22 for converging the beams in the sub-scanning direction, a scanning lens 26, a polygon mirror 24, the scanning lens 26, and a cylinder mirror 30 and the surface of a photosensitive body is irradiated with the beams as an optical spot. When the slit 16, the lens 18 and the lens 22 are detachably attached and their positions can be adjusted, three characteristic values of resolution, a beam diameter and light quantity can easily be changed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Date of extinction of right

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-213773

(43)公開日 平成10年(1998) 8月11日

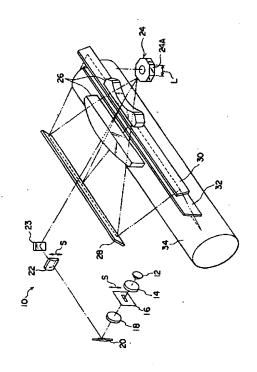
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I
G02B 26/	10	G 0 2 B 26/10 Z
		F
В41Ј 2/	44	B 4 1 J 3/00 D
H 0 4 N 1/11	113	H 0 4 N 1/04 1 0 4 B
		審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 14 頁)
(21)出願番号	特願平9-19496	(71)出顧人 000005496
	·	富士ゼロックス株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)1月31日	東京都港区赤坂二丁目17番22号
		(72)発明者 成沢 秀継
		神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ
		ックス株式会社海老名事業所内
		(74)代理人 弁理士 中島 淳 (外4名)
	•	

(54) 【発明の名称】 光学走査装置

(57)【要約】

【課題】 解像度(ビーム間隔)、ビーム径及び光量の 3つの特性値を容易に変更できる光学走査装置を提供す る事。

【解決手段】 副走査方向に二つの光点を有したレーザーダイオード12から射出された2本のビームを、コリメータレンズ14、スリット16、ビームを主走査方向に拡散させるエキスパンドレンズ18、ビームを副走査方向に集光させるシリンダレンズ22、走査レンズ26、ポリゴンミラー24、走査レンズ26、シリンダミラー30の順に通過させ、感光体34上で光スポットとなるように照射する。ここで、スリット16、エキスパンドレンズ18及びシリンダレンズ22を各々着脱自在とすると共に位置調整可能とすることにより、1台の装置で解像度、ビーム径及び光量の3つの特性値を容易に変更できるようになる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 副走査方向に対応する方向に所定間隔離 れた複数の光ビームを出射する光源と、前記光源から出 射された光ビームの少なくとも副走査方向の幅を制限す るスリットと、前記光ビームを主走査方向と対応する方 向に偏向させる偏向手段と、前記偏向手段で偏向された 前記光ビームを被走査体へ照射させる走査レンズと、を 有し、前記光ビームを前記走査レンズの正面から入射さ せ、前記走査レンズを通過した前記光ビームを前記偏向 手段を介して前記走査レンズの裏側から入射させて前記 10 沿って位置調整可能とされた直交レンズ保持手段と、 走査レンズを2回通過した前記光ビームを被走査体へ照 射させて画像記録を行う光学走査装置であって、

前記スリットと前記偏向手段との間に配置され透過した 前記光ビームを少なくとも主走査方向に対応した方向に 発散させるエキスパンドレンズと、

前記スリットと前記偏向手段との間に配置され透過した 前記光ビームを副走査方向に対応した方向にのみ集光さ せるシリンダレンズと、

前記スリットを着脱自在に保持すると共に光軸方向に沿 って位置調整可能とされたスリット保持手段と、

前記エキスパンドレンズを着脱自在に保持すると共に光 軸方向に沿って位置調整可能とされたエキスパンドレン ズ保持手段と、

前記シリンダレンズを着脱自在に保持すると共に光軸方 向に沿って位置調整可能とされたシリンダレンズ保持手 段と、

を有することを特徴とした光学走査装置。

【請求項2】 前記エキスパンドレンズは透過した光を 発散させる球面レンズであり、前記光源側から前記エキ スパンドレンズ及び前記シリンダレンズの順に配置され 30 ていることを特徴とする請求項1に記載の光学走査装 置。

【請求項3】 前記エキスパンドレンズは透過した光ビ ームを発散させる球面レンズであり、前記光源側から前 記シリンダレンズ及び前記エキスパンドレンズの順に配 置されていることを特徴とする請求項1に記載の光学走 查装置。

【請求項4】 前記エキスパンドレンズは透過した光ビ ームを主走査方向に対応した方向にのみ発散させ、前記 光源側から前記エキスパンドレンズ及び前記シリンダレ 40 ンズの順に配置されていることを特徴とする請求項1に 記載の光学走査装置。

【請求項5】 副走査方向に対応する方向に所定間隔離 れた複数の光ビームを出射する光源と、前記光源から出 射された光ビームの少なくとも副走査方向の幅を制限す るスリットと、前記光ビームを主走査方向と対応する方 向に偏向させる偏向手段と、前記偏向手段で偏向された 前記光ビームを被走査体へ照射させる走査レンズと、を 有し、前記光ビームを前記走査レンズの正面から入射さ

手段を介して前記走査レンズの裏側から入射させて前記 走査レンズを2回通過した前記光ビームを被走査体へ照 射させて画像記録を行う光学走査装置であって、

前記スリットと前記偏向手段との間に配置され、透過し た光ビームを主走査方向に対応した方向にのみ発散させ る主走査方向発散部と、透過した光ビームを副走査方向 にのみ集光させる副走査方向集光部とを有する1枚の直 交レンズと、

前記直交レンズを着脱自在に保持すると共に光軸方向に 前記スリットを着脱自在に保持すると共に光軸方向に沿 って位置調整可能とされたスリット保持手段と、 を有することを特徴とする光学走査装置。

【請求項6】 前記直交レンズは、片側に前記主走査方 向発散部と前記副走査方向発散部とを有し、反対側に平 面部を有するトーリックレンズであることを特徴とする 請求項5に記載の光学走査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、コピーマシン、フ 20 アックス、プリンタなどの光学走査装置、特に複数個の 光源を用い、複数本のビームを並列走査する光学走査装 置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のレーザープリンターでは、ポリゴ ンミラーを高速で動作させて光線走査を実現させてい る。この場合、装置が高速化、高解像度化するにつれ て、その動作を著しく高める必要があるが限度がある。

【0003】これに対処するために、複数個の光源を用 い、且つ各ビーム間隔を一定または調整する方法が特開 平2-160212号に提案されている。

【0004】しかし、この装置では、記録対象の種類が 異なるとき(例えば、形状が簡単な文字と複雑な図形) のために、感光体上のビーム間隔を変えられるようにし ているが、ビーム径と光量は変えることはできない。

【0005】ビーム径と光量を可変するための機構を持 った装置として、特開昭57-164759号に開示さ れた装置がある。この装置では、デュアルアレイレーザ を光源に用いて、発光点の一つをコリメータレンズの焦 点位置からずらして配置することで、感光体上のビーム 径が発光点AとBとで異なるようにできるので、発光点 A、B、A+Bを選ぶことで、3通りのビーム径と2通 りの光量を得ることができる。なお、この装置では、ビ 一ム間隔を変えることはできない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】したがって、従来で は、ビーム間隔とビーム径と光量の何れか1つを変える たびに新し光学走査装置を作る必要があった。しかも、 解像度の異なるシステムが発生することはよくあること せ、前記走査レンズを通過した前記光ビームを前記偏向 50 であり、また、感光体の感度が改善されたりすることで

30

光量を変えること等も発生しやすい状況にある。さら に、ハーフトーンの画質改善のためにビーム径を変える こともあり得る。

【0007】本発明は上記事実を考慮し、解像度(ビー ム間隔)、ビーム径及び光量の3つの特性値を容易に変 更できる光学走査装置を提供する事が目的である。

[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、副走査方向に対応する方向に所定間隔離れた複数の 光ビームを出射する光源と、前記光源から出射された光 10 ビームの少なくとも副走査方向の幅を制限するスリット と、前記光ビームを主走査方向と対応する方向に偏向さ せる偏向手段と、前記偏向手段で偏向された前記光ビー ムを被走査体へ照射させる走査レンズと、を有し、前記 光ビームを前記走査レンズの正面から入射させ、前記走 査レンズを通過した前記光ビームを前記偏向手段を介し て前記走査レンズの裏側から入射させて前記走査レンズ を2回通過した前記光ビームを被走査体へ照射させて画 像記録を行う光学走査装置であって、前記スリットと前 記偏向手段との間に配置され透過した前記光ビームを少 20 なくとも主走査方向に対応した方向に発散させるエキス パンドレンズと、前記スリットと前記偏向手段との間に 配置され透過した前記光ビームを副走査方向に対応した 方向にのみ集光させるシリンダレンズと、前記スリット を着脱自在に保持すると共に光軸方向に沿って位置調整 可能とされたスリット保持手段と、前記エキスパンドレ ンズを着脱自在に保持すると共に光軸方向に沿って位置 調整可能とされたエキスパンドレンズ保持手段と、前記 シリンダレンズを着脱自在に保持すると共に光軸方向に 沿って位置調整可能とされたシリンダレンズ保持手段 と、を有することを特徴としている。

【0009】次に、請求項1に記載の光学走査装置の作 用を説明する。請求項1に記載の光学走査装置では、光 源が副走査方向に対応する方向に所定間隔離れた複数の 光ビームを出射する。光源から出射された複数の光ビー ムは、少なくとも副走査方向の幅がスリットで制限され る。

【0010】エキスパンドレンズは、スリットを通過し た複数の光ビームを少なくとも主走査方向に対応した方 向に発散させる。

【0011】シリンダレンズは、スリットを通過した複 数の光ビームを副走査方向にのみ集光させる。

【0012】なお、光源側からエキスパンドレンズ、シ リンダレンズの順に配置することもでき、シリンダレン ズ、エキスパンドレンズの順に配置することもできる。

【0013】エキスパンドレンズ及びシリンダレンズを 通過した複数の光ビームは、走査レンズの正面から入射 する。その後、走査レンズを通過した複数の光ビームは 偏向手段を介して走査レンズの裏側から入射し、走査レ ンズを2回通過した複数の光ビームは被走査体へ照射さ 50 リンダレンズを通過して副走査方向に対応した方向に集

れる。

【0014】ここで、複数の光ビームは、エキスパンド レンズで少なくとも主走査方向に広げられ、また、副走 査方向に対応した方向にのみ屈折力を有するシリンダレ ンズを通過することで偏向手段上で焦点を結ばせること ができ、偏向手段上において、副走査方向の所定のビー ム幅及び所定のビーム間隔にできる(即ち、偏向手段上 で各々の光ビームを主走査方向に長い線状にでき

る。)。このとき、複数の光ビームは、主走査方向につ いては、走査レンズを通過させることで略平行にして偏 向手段に入射させることができ、偏向手段で偏向させて さらに走査レンズを通過させることで被走査体上で焦点 を結ばせる。これにより、被走査体上で、所定間隔、所 定径、所定の光量の光スポットを形成できる。

【0015】なお、スリットで光ビームの副走査方向に 対応した幅を変えることで、被走査体上での光ビームの 副走査方向のビーム径が変わるので、異なる大きさのス リットに交換することで被走査体上での光ビームの副走 査方向のビーム径を変えることができる。また、スリッ トで光ビームの主走査方向に対応した長さを変えること もできるので、異なる大きさのスリットに交換すること で被走査体上での光ビームの主走査方向のビーム径を変 えることもできる。

【0016】また、エキスパンドレンズの屈折力、エキ スパンドレンズの光軸方向の位置、を変えることによ り、偏向手段に入射する光ビームの主走査方向に対応し た方向の長さを変更でき、これにより、被走査体上での 光量を変更することができる。例えば、入射する光ビー ムの主走査方向に対応した方向の長さを偏向手段の反射 面よりも長くすれば、反射偏向される光ビームの光量を 減らすことが可能となる。

【0017】また、シリンダレンズの屈折力、シリンダ レンズの光軸方向の位置を変えることによって、偏向手 段に入射する光ビームの副走査方向に対応した方向のビ ーム間隔及びビーム径を偏向できる。

【0018】本発明の光学走査装置では、スリット、エ キスパンドレンズ及びシリンダレンズが、各々スリット 保持手段、エキスパンドレンズ保持手段及びシリンダレ ンズ保持手段に対して着脱自在であり、かつ位置調整可 40 能であるため、1台の装置で解像度(ビーム間隔)、ビ ーム径及び光量の3つの特性値を容易に変更できる。

【0019】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載 の光学走査装置において、前記エキスパンドレンズは透 過した光を発散させる球面レンズであり、前記光源側か ら前記エキスパンドレンズ及び前記シリンダレンズの順 に配置されていることを特徴としている。

【0020】次に、請求項2に記載の光学走査装置の作 用を説明する。請求項2に記載の光学走査装置では、複 数の光ビームが球面レンズを通過して発散し、次に、シ 光して偏向手段に入射する。

【0021】なお、球面レンズの位置及び屈折力により 被走査体に入射する複数の光ビームの間隔を決めること ができ、例えば、複数の光ビームを隣接させて走査する 隣接走査が可能となる。請求項3に記載の発明は、請求 項1に記載の光学走査装置において、前記エキスパンド レンズは透過した光ビームを発散させる球面レンズであ り、前記光源側から前記シリンダレンズ及び前記エキス パンドレンズの順に配置されていることを特徴としてい る。

【0022】次に、請求項3に記載の光学走査装置の作 用を説明する。請求項3に記載の光学走査装置では、複 数の光ビームがシリンダレンズを通過して副走査方向に 対応した方向に集光し、次に、エキスパンドレンズを通 過して発散して偏向手段に入射する。

【0023】なお、エキスパンドレンズの位置及び屈折 力により被走査体に入射する複数の光ビームの間隔を決 めることができ、例えば、複数の光ビームを飛び越して 走査する飛び越し走査が可能となる。

【0024】請求項4に記載の発明は、請求項1に記載 20 の光学走査装置において、前記エキスパンドレンズは透 過した光ビームを主走査方向に対応した方向にのみ発散 させ、前記光源側から前記エキスパンドレンズ及び前記 シリンダレンズの順に配置されていることを特徴として いる。

【0025】次に、請求項4に記載の光学走査装置の作 用を説明する。請求項4に記載の光学走査装置では、複 数の光ビームがエキスパンドレンズを通過して主走査方 向に対応した方向にのみ発散し、次に、シリンダレンズ を通過して副走査方向に対応した方向に集光して偏向手 30 段に入射する。

【0026】なお、エキスパンドレンズの位置及び屈折 力により被走査体に入射する複数の光ビームの間隔を決 めることができ、例えば、複数の光ビームを飛び越して 走査する飛び越し走査が可能となる。

【0027】請求項5に記載の発明は、副走査方向に対 応する方向に所定間隔離れた複数の光ビームを出射する 光源と、前記光源から出射された光ビームの少なくとも 副走査方向の幅を制限するスリットと、前記光ビームを 主走査方向と対応する方向に偏向させる偏向手段と、前 40 被走査体上での光ビームの主走査方向のビーム径を変え 記偏向手段で偏向された前記光ビームを被走査体へ照射 させる走査レンズと、を有し、前記光ビームを前記走査 レンズの正面から入射させ、前記走査レンズを通過した 前記光ビームを前記偏向手段を介して前記走査レンズの 裏側から入射させて前記走査レンズを2回通過した前記 光ビームを被走査体へ照射させて画像記録を行う光学走 査装置であって、前記スリットと前記偏向手段との間に 配置され、透過した光ビームを主走査方向に対応した方 向にのみ発散させる主走査方向発散部と、透過した光ビ ームを副走査方向にのみ集光させる副走査方向集光部と 50

を有する1枚の直交レンズと、前記直交レンズを着脱自 在に保持すると共に光軸方向に沿って位置調整可能とさ れた直交レンズ保持手段と、前記スリットを着脱自在に 保持すると共に光軸方向に沿って位置調整可能とされた スリット保持手段と、を有することを特徴としている。 【0028】次に、請求項5に記載の光学走査装置の作 用を説明する。請求項5に記載の光学走査装置では、光 源が副走査方向に対応する方向に所定間隔離れた複数の 光ビームを出射する。光源から出射された複数の光ビー 10 ムは、少なくとも副走査方向の幅がスリットで制限され る。

【0029】直交レンズにおいて、主走査方向発散部 は、スリットを通過した複数の光ビームを少なくとも主 走査方向に対応した方向に発散させ、副走査方向集光部 は複数の光ビームを副走査方向にのみ集光させる。

【0030】直交レンズを通過した複数の光ビームは、 走査レンズの正面から入射する。その後、走査レンズを 通過した複数の光ビームは偏向手段を介して走査レンズ の裏側から入射し、走査レンズを2回通過した複数の光 ビームは被走査体へ照射される。

【0031】ここで、複数の光ビームは、主走査方向発 散部で少なくとも主走査方向に広げられ、また、副走査 方向集光部を通過することで偏向手段上で焦点を結ばせ ることができ、偏向手段上において、副走査方向の所定 のビーム幅及び所定のビーム間隔にできる(即ち、偏向 手段上で各々の光ビームを主走査方向に長い線状にでき る。)。このとき、複数の光ビームは、主走査方向につ いては、走査レンズを通過させることで略平行にして偏 向手段に入射させることができ、偏向手段で偏向させて さらに走査レンズを通過させることで被走査体上で焦点 を結ばせる。これにより、被走査体上で、所定間隔、所 定径、所定の光量の光スポットを形成できる。

【0032】なお、スリットで光ビームの副走査方向に 対応した幅を変えることで、被走査体上での光ビームの 副走査方向のビーム径が変わるので、異なる大きさのス リットに交換することで被走査体上での光ビームの副走 査方向のビーム径を変えることができる。 また、スリッ トで光ビームの主走査方向に対応した長を変えることも できるので、異なる大きさのスリットに交換することで ることもできる。

【0033】また、直交レンズを変え、また位置調整す ることにより、偏向手段に入射する光ビームの主走査方 向に対応した方向の長さを変更でき、これにより、被走 査体上での光量を変更することができる。例えば、入射 する光ビームの主走査方向に対応した方向の長さを偏向 手段の反射面よりも長くすれば、反射偏向される光ビー ムの光量を減らすことが可能となる。また、偏向手段に 入射する光ビームの副走査方向に対応した方向のビーム 間隔及びビーム径を偏向できる。

【0034】本発明の光学走査装置では、スリット及び 直交レンズが、各々スリット保持手段及び直交レンズ保 持手段に対して着脱自在であり、かつ位置調整可能であ るため、1台の装置で解像度(ビーム間隔)、ビーム径 及び光量の3つの特性値を容易に変更できる。また、直 交レンズ1つが、シリンダレンズ及びエキスパンドレン ズの2つのレンズ機能を有しているので、構成が簡単に なり、調整箇所も減る。

【0035】請求項6に記載の発明は、請求項5に記載 記主走査方向発散部と前記副走査方向発散部とを有し、 反対側に平面部を有するトーリックレンズであることを 特徴としている。

【0036】次に、請求項6に記載の光学走査装置の作 用を説明する。請求項6に記載の光学走査装置では、ト ーリックレンズは、片面のみの研磨でレンズを製作で き、反対面が平面であるので、レンズコストを低減でき る。また、一面が平面であるため、レンズを取り付け易 くなり、組立工数を低減することも可能となる。

[0037]

【発明の実施の形態】

[第1の実施形態] 本発明に係る光学走査装置の第1の 実施形態を図1乃至図13にしたがって説明する。

【0038】図1及び図2に示すように、光学走査装置 10には、レーザーダイオード12、コリメータレンズ 14、スリット16、エキスパンドレンズ18、折返ミ ラー20、シリンダレンズ22、折返ミラー23、ポリ ゴンミラー24、走査レンズ ($f \theta$ レンズ) 26、折返 ミラー28、シリンダミラー30、ウインドウ32を備 えている。

【0039】なお、レーザーダイオード12が本発明の 光源手段に相当し、ポリゴンミラー24が本発明の偏向 手段に相当する。

【0040】図3の光学系の模試図で示すように、レー ザーダイオード12は、副走査方向(矢印S方向)に対 応する方向に互いに所定間隔離れた二つの光点12A及 び12Bを有している。光点12A、 Bからは出射され る光は各々発散している。なお、レーザーダイオード1 2は、図示しない変調手段により画像信号に応じてオン オフ制御される。

【0041】図2及び図3に示すように、コリメータレ ンズ14は、透過した2本のレーザービームA、Bをほ ぼ平行な平行ビームとする。

【0042】スリット16は、副走査方向と対応した方 向(矢印S方向)の不要のビームをカットすることで、 被走査体としての感光体34での所望のビーム径となる ようにし、主走査方向に対応した方向の不要のビームを カットすることで、ポリゴンミラー24での主走査方向 に対応した方向のビーム幅が所望の大きさとなるように する。

【0043】本実施形態の光学走査装置10の光学系 は、オーバーフィールドと呼ばれる光学系であり、ポリ ゴンミラー24に入射する2本のレーザービームA, B は、各々の主走査方向のビーム幅がポリゴンミラー24 の一面24Aの長さLよりも大きく、隣接面にも洩れた 状態である。

【0044】スリット16を通過した2本のレーザービ ームA, Bは、凹の球面レンズであるエキスパンドレン ズ18を通過して発散光となり、折返ミラー20で折り の光学走査装置において、前記直交レンズは、片側に前 10 返された後、副走査方向にのみ屈折力を有する凸のシリ ンダレンズ22を通過して副走査方向にのみ集光され、 折返ミラー23を介して走査レンズ26の正面から入射 し、走査レンズ26を介して副走査方向に焦点を結ぶ形 でポリゴンミラー24に入射する。

> 【0045】ポリゴンミラー24で反射偏向されたビー ムは、走査レンズ26を通過し、折返ミラー28で折り 返され、副走査方向にのみ屈折力を持つシリンダミラー 30で反射されてウインドウ32を介して被走査体とし ての感光体34に至る。

【0046】ここで、スリット16は、例えば図4に示 20 すように、略コ字状のホルダー40の溝42に着脱自在 挿入されており、通常はホルダー40に螺子44で固定 される板ばね46で押えられている。また、ホルダー4 0は、光軸方向に沿って光学走査装置10の筐体47の 上に配置されたレール48に沿って移動自在とされたス ライドベース50の上に一体的に取り付けられている。 このスライドベース50は、位置調整後、螺子52により って筐体47に固定される。

【0047】なお、シリンダレンズ22もスリット16 30 と同様にしてホルダー40に着脱自在とされ、かつ光軸 方向に位置調整可能となっている。

【0048】エキスパンドレンズ18は、例えば図5に 示すように、ホルダー54の丸孔56に着脱自在挿入さ れており、通常は丸孔56に形成されたねじ58に螺合 したリング状のレンズ押え60で押えられている。な お、このホルダー54も、前記ホルダー40と同様にス ライドベース50の上に一体的に取り付けられており、 レール48に沿って光軸方向に位置調整可能となってい

【0049】次に、本実施形態の作用を説明する。レー ザーダイオード12の2つの光点12A, Bから出射さ れた2つの発散光は、コリメータレンズ14によってほ ぼ平行な光ビームとされ、さらにスリット16によって ビーム幅が所定の幅に制限される。

【0050】次に、スリット16を通過した光ビーム A, Bは、球面レンズであるエキスパンドレンズ18を 通過して各々が主・副走査方向に弱発散光になると共に ビーム間隔が副走査方向に対応した方向に広がり、折返 ミラー20で折り返された後、シリンダレンズ22を通 50 過する。

【0051】光ビームA、Bは、シリンダレンズ22を 通過することによって副走査方向に対応する方向にのみ 集光され、ビーム間隔が狭まって走査レンズ26の正面 から入射し、走査レンズ26を介して副走査方向に対応 した方向に焦点を結ぶ形でポリゴンミラー24に入射す る。このとき、ポリゴンミラー24の反射面では、光ビ ームA、Bは各々主走査方向に対応した方向に長い線状 となる。

【0052】ポリゴンミラー24に収束された光ビーム A、Bは、ポリゴンミラー24で反射偏向されて走査レ 10 ンズ26に入射する。

【0053】光ビームA、Bは、走査レンズ26を2回 通過することにより、この走査レンズ26の主走査方向 の屈折力によって、主走査方向において感光体34の表 面に所定のビーム径の略円形の光スポットa,bとして 各々収束する。

【0054】ポリゴンミラー24の回転及び走査レンズ 26の作用により、光スポットa, bは主走査方向に一 定速度で走査される。また、感光体34が主走査方向と 直交方向に移動することで副走査が行われ、これにより 20 は、 $X=73\,\mathrm{mm}$ 、 $Y=118\,\mathrm{mm}$ の位置にそれぞれのレン 感光体34上に画像(潜像)が形成される。

【0055】ここで、本実施形態では、隣接走査を行う ことができる。隣接走査とは、感光体34上に2ビーム を書き込む時に、例えば、600spiの解像度の画像 を書くときは、光スポットa, bが42.3μmの間隔 となるように書き込むことをいう。

【0056】この場合、レーザーダイオード12から走 査レンズ26までの光学系(以後プレポリゴンと呼ぶ) の副走査方向に対応した方向の光学倍率を0.387倍 とし、ポリゴンミラー24からウインドウ32までの光 30 学系(以後、ポストポリゴンと呼ぶ)の副走査方向に対 応した方向の光学倍率を7.75倍とすることで実現で きる。なお、ポストポリゴンの副走査方向に対応した方 向の光学倍率は1倍以下にすることが好ましい。

【0057】ここで、本実施形態では、スリット16が 交換可能となっているので、スリットの大きさの異なる 他のスリット16に交換することで、感光体34での光 スポットa, bの径d (図3参照) 及び光量を変更する ことができる。

【0058】また、エキスパンドレンズ18及びシリン 40 ダレンズ22が交換可能となっており、且つ位置調整可 能となっているので、これにより、感光体34での光ス ポットa, bの副走査方向のビーム間隔及び径dを変え ることができる。即ち、ビーム間隔を変更することで解 像度の変更を行う。

【0059】以下に、本実施形態をモデルとして、光 量、ビーム径及び解像度を変更する具体的な説明を行 う。

【0060】先ず、図6のグラフにおいて、プレポリゴ

10

ドレンズ18までの距離がX、シリンダレンズ22まで の距離がYである。また、以後述べられる光量Cは、レ ーザーダイオード12と感光体34上の光量の効率で表 している(光量C=感光体34上の光量/レーザーダイ オード12の光量)。

【0061】この図6においては、光量Cを6%として いる。例えば、レーザーダイオード12の最大出力が2 0mWであれば、感光体34上には、1.2mWのビー ムが照射されることになる。また、この例は、隣接走査 をするケースである。

【0062】例えば、感光体34上でのビーム径(即 ち、光スポットa, bの径)を40μmとし、解像度を 600spiとする時は、図6のグラフより、X=10 0 mm、Y=6 mmの位置にそれぞれのレンズを配置すれば 良いことが分かる。

【0063】また、この光学走査装置10の仕様変更 で、例えば、800spiの解像度が必要となったとき は、X=92mm、Y=50mmの位置にそれぞれのレンズ を配置し、1200spiの解像度が必要となったとき ズを配置すれば良いことが分かる。

【0064】つまり、エキスパンドレンズ18及びシリ ンダレンズ22の種類と配置位置を変えるのみで、他の 光学部品を一切触れずに解像度の変更を実施することが できる。ここで、解像度の変更に応じた各レンズの移動 量を予め確保しておくのは勿論である。

【0065】なお、光スポットa, bの径50μm又は 60 μmで解像度を変更するときも図6に示すように解 像度の変更が実施可能である。

【0066】図7では、光量Cが6%、解像度が60 0,800及び1200spiの3つの場合で、光スポ ットa, bの径dを変更したいときのエキスパンドレン ズ18の距離Xシリンダレンズ22の距離Yを求めてい

【0067】図8では、解像度が600spi、光スポ ットa, b の径 d が 4 0, 5 0 及び 6 0 μ m の 3 つ の 場 合で、光量Cを変更したいときのエキスパンドレンズ1 8の距離 X 及びシリンダレンズ 2 2 の距離 Y を求めてい る。

【0068】図9では、光量Cが6%で光スポットa, bの径が40μmの場合と、光量Cが6%で光スポット a, bの径が50μmの場合と、さらに、光量Cが6% で光スポットa, bの径が60μmの場合で解像度を変 更したいときのエキスパンドレンズ18の距離Xとスリ ット16の副走査方向の幅 t を求めている。

【0069】図10では、光量Cが6%で解像度が60 Ospiの場合と、光量Cが6%で解像度が800sp iの場合と、さらに、光量Cが6%で解像度が1200 spiの場合で光スポットa, bの径を変更したいとき ンの折返ミラー20の反射面を基準として、エキスパン 50 のエキスパンドレンズ18の距離Xとスリット16の副 走査方向の幅 t を求めている。

【0070】図11では、解像度が600spiで光ス ポットa, bの径が40μmの場合と、解像度が600 spiで光スポットa, bの径が50μmの場合と、解 像度が600spiで光スポットa, bの径が60μm の場合で光量Cを変更したいときのエキスパンドレンズ 18とスリット16の副走査方向の幅 t を求めている。

【0071】なお、エキスパンドレンズ18の距離X位 置とシリンダレンズ22の距離Yを変えると、それぞれ のレンズの曲率半径は当然かわることになり、例えば、 図12, 13のようになる。

【0072】これらの図12、13からも判るように、 ポストポリゴンを変えない時は、図のような配置位置で レンズの曲率半径は一義的に決まるものである。よっ て、図6~11におけるそれぞれのレンズ位置に対応す るレンズがある。これは、光スポットa, bの間隔、ビ ームの焦点位置を合わせるために1ヵ所を移動すると、 これに対応して別の場所が決まるわけである。

[第2の実施形態] 本発明に係る光学走査装置の第2の 実施形態を図14にしたがって説明する。なお、第1の 20 実施形態と同一構成に関しては同一符号を付し、その説 明は省略する。

【0073】本実施形態の光学走査装置10では、部品 構成は第1の実施形態とほぼ同じであるが、光ビーム A, Bは、スリット16を通過した後に、副走査方向に のみ屈折力を有する凸のシリンダレンズ22、折返ミラ ー20及び凹の球面レンズであるエキスパンドレンズ1 8を順に通過する。なお、以降の構成は第1の実施形態 と同一である。

【0074】本実施形態では、光ビームA, Bを用い、 感光体34上で飛び越し走査を行うことができる。飛び 越し走査とは、感光体34上に2ビームを書き込む時 に、例えば600spiの解像度の画像を書くときに、 光スポットa, bが42.3 μ mの奇数倍した間隔とな るように書き込むことをいう。

【0075】飛び越し走査は、本実施形態の場合、プレ ポリゴンの副走査方向に対応した方向の光学倍率を 0. 387倍とし、ポストポリゴンの副走査方向に対応した 方向の光学倍率を23.26倍とすることで実現でき、 これにより3ライン飛ばしの飛び越し走査を行うことが 40

[第3の実施形態] 本発明に係る光学走査装置の第3の 実施形態を図15にしたがって説明する。なお、前述し た実施形態と同一構成に関しては同一符号を付し、その 説明は省略する。

【0076】本実施形態の光学走査装置10では、部品 構成は第1の実施形態とほぼ同じであるが、光ビーム A, Bは、スリット16を通過した後に、主走査方向に のみ屈折力を有する凹のシリンダレンズであるエキスパ ンドレンズ62、折返ミラー20及び副走査方向にのみ 50 応した方向の光学倍率を0.387倍とし、ポストポリ

12

屈折力を有する凸のシリンダレンズ22を順に通過す る。なお、以降の構成は第1の実施形態と同一である。 また、このエキスパンドレンズ62も、前述した実施形 態と同様にホルダー40に着脱自在とされ、かつ光軸方 向に位置調整可能となっている。

【0077】本実施形態においても、第2の実施形態と 同様に光ビームA、Bを用い、感光体34上で飛び越し 走査を行うことができ、プレポリゴンの副走査方向に対 応した方向の光学倍率を0.387倍とし、ポストポリ 10 ゴンの副走査方向に対応した方向の光学倍率を23.2 6倍とすることで実現でき、これにより3ライン飛ばし の飛び越し走査を行うことができる。

[第4の実施形態] 本発明に係る光学走査装置の第4の 実施形態を図16にしたがって説明する。なお、前述し た実施形態と同一構成に関しては同一符号を付し、その 説明は省略する。

【0078】本実施形態の光学走査装置10では、部品 構成は第1の実施形態とほぼ同じであるが、スリット1 6と折返ミラー20との間に、一方に主走査方向に対応 した方向にのみ負の屈折力を有し、他方に副走査方向に 対応した方向にのみ正の屈折力を有する1枚の直交シリ ンダレンズ64が配置されている。なお、この直交シリ ンダレンズ64も、前述した実施形態と同様にホルダー 40に着脱自在とされ、かつ光軸方向に位置調整可能と なっている。

【0079】このように、本実施形態では前述したエキ スパンドレンズ62とシリンダレンズ22を1枚の直交 シリンダレンズ64に置き換えることができるため、レ ンズ配置のためのスペースが1ヵ所不要となり、光学走 30 査装置10の筐体47の設計の自由度を増すことがで き、レンズコストの低減にも寄与できる。

【0080】また、本実施形態においても、直交シリン ダレンズ64の交換及び位置調整により、ビーム間隔や ビーム径を変更でき、調整も1箇所で済む。

[第5の実施形態] 本発明に係る光学走査装置の第5の 実施形態を図17にしたがって説明する。

【0081】本実施形態の光学走査装置10は、前記第 3の実施形態で説明した直交シリンダレンズ64をトー リックレンズ66に置き換えた例である。

【0082】図17に示すように、トーリックレンズ6 6は、一方の側に主走査方向に対応した方向の負の屈折 力と副走査方向に対応した方向(矢印S方向)の正の屈 折力を得るための曲面66Aを有し、反対側に平面部6 6 Bを有している。

【0083】このトーリックレンズ66は、平面部66 Bを有しているので、取り付けが容易になる。

【0084】本実施形態においても、第2の実施形態と 同様に光ビームA、Bを用い、感光体34上で飛び越し 走査を行うことができ、プレポリゴンの副走査方向に対 ゴンの副走査方向に対応した方向の光学倍率を23.2 6倍とすることで実現でき、これにより3ライン飛ばし の飛び越し走査を行うことができる。

【0085】なお、前記実施形態では、光路中に折返ミ ラー20、折返ミラー23を配置しているが、この折返 ミラーは光学部品のレイアウトにより有無が決まるた め、必ずしも必要ではない。

【0086】また、上記実施形態では、オーバーフィー ルド光学系を用いて本発明を説明したが、本発明はアン ダーフィールド光学系(ポリゴンミラーの反射面に入射 10 するレーザービームの主走査方向のビーム幅を、反射面 の主走査方向の長さ以下に設定した光学系)にも適用で きる。この場合には、スリット位置は、エキスパンドレ ンズよりもポリゴンミラー側に配置することが必要とな

【0087】また、上記実施形態では、レール48に沿 ってスライドベース50を移動させる構成により、レン ズの位置調整を可能としたが、レンズを光軸方向に沿っ て移動できれば他の構成であっても良い。

【0088】また、図5に示すように、筐体47に、ス 20 ズの距離Yとの関係を示すグラフである。 ライドベース50 (レンズ) の移動量を見るための目盛 り70を設ける事が好ましい。

[0089]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1乃至請求 項6に記載の光学走査装置は、解像度(ビーム間隔)、 ビーム径及び光量の3つの特性値を容易に変更できる、 という優れた効果を有する。

【0090】請求項5、6に記載の光学走査装置では、 構成が簡単になり、調整箇所も減らせる、という優れた 効果を有する。

【0091】また、請求項6に記載の光学走査装置で は、トーリックレンズを用いたので、レンズの取り付け が容易になり、組立工数を低減することも可能となる、 という優れた効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る光学走査装置の 斜視図である。

【図2】図1に光学走査装置の平面図である。

【図3】図1に示す光学走査装置の光学系の模試図であ

【図4】 スリットを保持するホルダーの斜視図である。

【図5】 凹球面のエキスパンドレンズを保持するホルダ ーの斜視図である。

【図6】光量及びスポット径を決めて解像度を変化させ る場合のエキスパンドレンズの距離Xとシリンダレンズ の距離Yとの関係を示すグラフである。

14

【図7】 光量及び解像度を決めて光スポット径を変化さ せる場合のエキスパンドレンズの距離Xとシリンダレン ズの距離Yとの関係を示すグラフである。

【図8】解像度及び光スポット径を決めて光量を変化さ せる場合のエキスパンドレンズの距離Xとシリンダレン ズの距離Yとの関係を示すグラフである。

【図9】光量と光スポットの径を決めて解像度を変化さ せる場合のエキスパンドレンズの距離Xとスリットの副 走査方向の幅 t との関係を示すグラフである。

【図10】光量と解像度を決めて光スポットの径を変化 させる場合のエキスパンドレンズの距離Xとスリットの 副走査方向の幅 t との関係を示すグラフである。

【図11】解像度と光スポットの径を決めて光量を変化 させる場合のエキスパンドレンズの距離Xとスリットの 副走査方向の幅 t との関係を示すグラフである。

【図12】エキスパンドレンズ及びシリンダレンズの各 曲率半径とエキスパンドレンズの距離Xとの関係を示す グラフである。

【図13】エキスパンドレンズの距離Xとシリンダレン

【図14】本発明の第2の実施形態に係る光学走査装置 の平面図である。

【図15】本発明の第3の実施形態に係る光学走査装置 の平面図である。

【図16】本発明の第4の実施形態に係る光学走査装置 の平面図である。

【図17】本発明の第4の実施形態に係る光学走査装置 に用いるトーリックレンズの斜視図である。

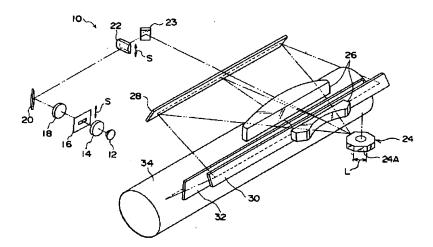
【符号の説明】

- 30 1 0 光学走査装置
 - レーザーダイオード (光源手段) 1 2
 - 16 スリット
 - エキスパンドレンズ 18
 - 2.2 シリンダレンズ
 - ポリゴンミラー (偏向手段) 24
 - 走査レンズ 26
 - 感光体 (被走查体) 3 4
 - ホルダー(スリット保持手段、シリンダレンズ 4 0 保持手段)
- 40 5 0 スライドベース(スリット保持手段、エキスパ ンドレンズ保持

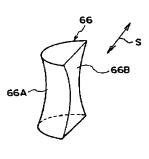
手段、シリンダレンズ保持手段)

- ホルダー (エキスパンドレンズ保持手段) 5 4
- 6 2 エキスパンドレンズ
- 64 直交シリンダレンズ (直交レンズ)
- 66 トーリックレンズ

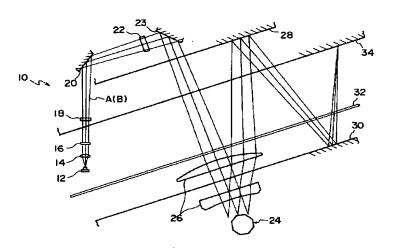
·【図1】



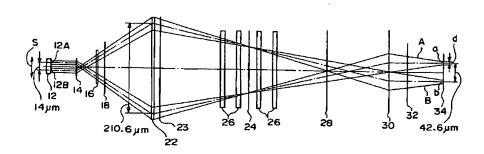
【図17】



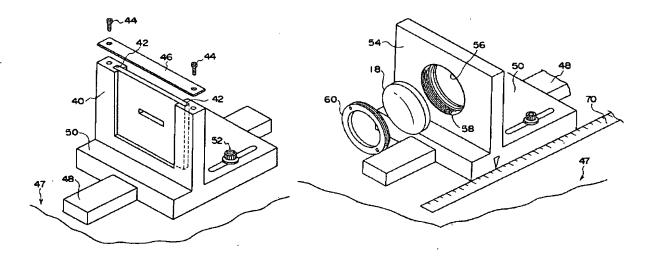
【図2】



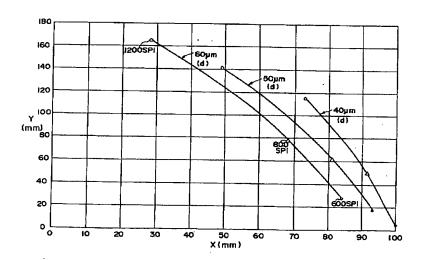
【図3】



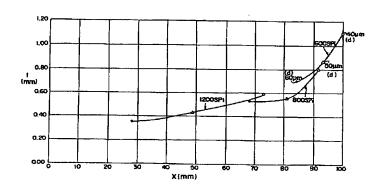
[図4] 【図5]



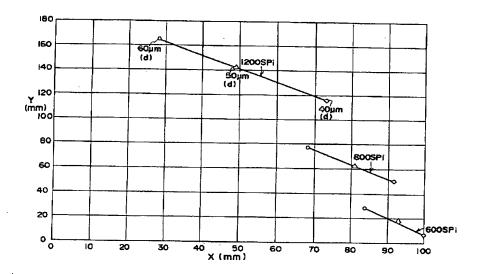
[図6]



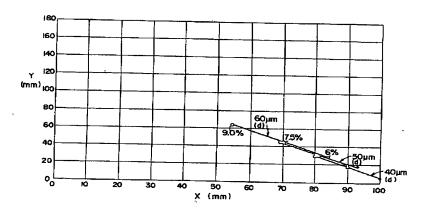
【図10】



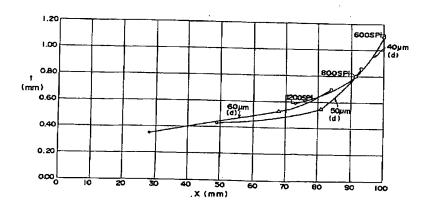
【図7】



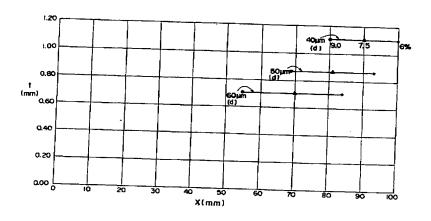
【図8】



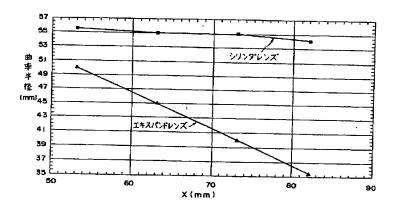
【図9】



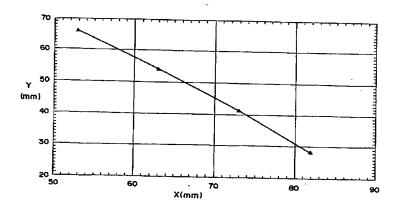
【図11】



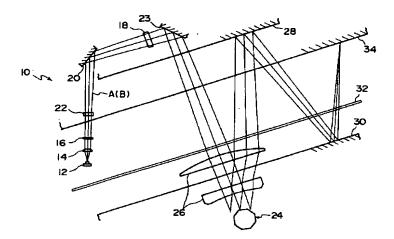
【図12】



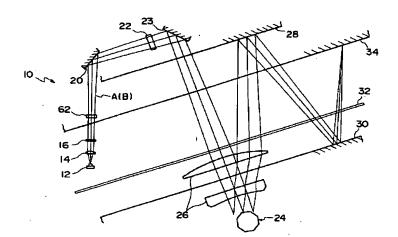
【図13】



[図14]



【図15】



【図16】

